1. รายการบรรณานุกรม

11.Name (Author Name or Corporate name) : Challener, Cynthia

1.2 Article Title : Photoresists : shaping the future of electronics technology

1.3 Journal Title : JCT Coating Tech

Vol. - No. - Year 2006 Page 54 – 59

2. ชื่อภาษาไทย (ชื่อแปล)

สารไวแสง : การเปลี่ยนรูปแบบของเทคโนโลยีทางไฟฟ้าในอนาคต

3. สรุปสาระสำคัญ / บทคัดย่อภาษาไทย

ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีของสารกึ่งตัวนำส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตสารไวแสงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบแผงวงจรบนแผ่นซิลิกอนเวฟอร์ (silicon wafer) ที่มีขนาดเล็ก สารไวแสง (photoresist) จะประกอบด้วยพอลิเมอร์ที่ไวต่อแสงซึ่งถูกวางไว้บนซิลิกอนเวฟอร์ รายละเอียดของการทำสารไวแสงนั้นได้อธิบายไว้ในบทความนี้ ด้วยข้อจำกัดมากมายของเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ทำให้ซิลิกอนพอลิเมอร์ได้รับความนิยมมากขึ้น และความต้องการด้านการเคลือบเพื่อต้านการสะท้อนก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อขนาดของแผงวงจรมีขนาดเล็กลง เทคนิคการทำสารไวแสงนี้ได้อาศัยวิธีการที่เรียกว่า immersion lithography ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำได้นำมาใช้และกำลังเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ผลิตสารไวแสงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดในอนาคตอันใกล้นี้